# Установка плазмохимического травления Vision 320 RIE

Установка плазмохимического травления Vision 320 RIE

Image not found or type unknown

| Производитель: | Цена: |
| --- | --- |
| Plasma-Therm | Цена по запросу |

## Описание

Vision 320 RIE компании Plasma-Therm — это компактная, надежная, технологически гибкая и простая в эксплуатации и обслуживании установка плазмохимического и реактивного ионного травления для R&D-лабораторий и мелкосерийных производств.

**Установка Vision 320 RIE позволяет травить следующие виды материалов:**

- Диэлектрики: оксиды, нитриды.
- Полупроводниковые материалы: кремний, германий, материалы группы AIIIBV — GaAs, GaN, InP, InGaAs и другие.
- Полимеры: резисты, полиимиды.

## Ключевые преимущества установки Vision 320 RIE:

- Большая область загрузки — круглый стол диаметром 305 мм, который позволяет обрабатывать подложки разных форм и размеров.
- Равномерность травления по толщине и воспроизводимость результатов от пластины к пластине — лучше ±3%.
- В комплекте с установкой поставляется библиотека стандартных технологических процессов, которые гарантируются производителем.
- Простой, интуитивно понятный интерфейс.
- История аварийный сообщений, контроль рецептов в процессе работы — вывод данных о процессе на дисплей в режиме реального времени.
- Программное обеспечение позволяет записывать параметры процессов для дальнейшего анализа.
- Многоуровневый доступ пользователей.
- Возможность удаленного управления и контроля состояния системы.
- Наличие различных вариантов системы отслеживания окончания процесса (OES, OEI, LEPD).

- Современная архитектура на основе ПЛК и DeviceNet: безопасная работа, легкая диагностика и минимальное количество проводов.
- Простота использования и обслуживания.
- Малая занимаемая площадь
- Возможность установки через стену чистого производственного помещения.
- Опциональное оснащение боксом для работы с токсичными и коррозионными газами.
- Возможность изготовления опций и оснастки «под заказ».

## Основные опции

- Система отслеживания окончания процесса:
    - Оптическая эмиссионная спектроскопия (OES)
    - Оптическая эмиссионная интерферометрия (OEI)
    - Лазерная интерферометрия (LEPD),
- Сухой форвакуумный насос,
- ТМН на магнитном подвесе,
- Дополнительные газовые линии (до 10 в сумме),
- Расширение температурного интервала электрода (например, –25…+60 С, либо диапазон на заказ),
- Перчаточный бокс,
- Специальные держатели образцов,
- Нагреватели вакуумной камеры и вакуумного тракта,
- Удаленный мониторинг состояния системы SECS/GEM,
- Пакет для установки через стенку ЧПП,
- Размещение газового шкафа отдельно от каркаса установки,
- Расширенная гарантия производителя,
- Специальные опции под заказ

## Основные технические характеристики установки Vision 320 RIE

| | |
|---|---|
| Размер электрода | 12″ (305 мм) в диаметре |
| Температура электрода | Определяется типом процесса. Используется чиллер. Стандартно +5…45 °C, доступны другие варианты |
| Материал электрода | Алюминий с графитовым покрытием. Опционально доступны другие материалы |
| Тип плазмы | Емкостная |
| ВЧ-генератор | 600 Вт, 13,56 МГц |

| | |
|---|---|
| Вакуумная камера | Изготовлена из цельного блока алюминия.<br>Опциональная внешняя система прогрева |
| Откачная система | Форвакуумный насос 40–100 м3/ч, масляный или безмасляный<br>Турбомолекулярный насос 250–350 л/с с керамическими подшипниками<br>Возможна установка других насосов по ТЗ заказчика |
| Уровень вакуума | <10-6 торр |
| Контроль давления процесса | Автоматический |
| Газовые линии с цифровыми РРГ | 4 линии (стандартно). Опционально до 10 линий |
| Система контроля, ПО | ПЛК (XP/Windows 7), DeviceNet |
| Электропитание | 380 В, 50 Гц, 3 фазы |
| Габариты установки (Ш×Г×В) | 730×934×2147 мм с газовым шкафом на каркасе<br>730×934×1172 мм без газового шкафа на каркасе<br>Возможно размещение газового шкафа отдельно от каркаса установки. |
| Сертификация | CE, SEMI-2, S8 |